

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】令和3年11月18日(2021.11.18)

【公表番号】特表2020-536736(P2020-536736A)

【公表日】令和2年12月17日(2020.12.17)

【年通号数】公開・登録公報2020-051

【出願番号】特願2020-540846(P2020-540846)

【国際特許分類】

B 01 J 19/10 (2006.01)

B 01 F 11/00 (2006.01)

C 08 J 3/20 (2006.01)

【F I】

B 01 J 19/10

B 01 F 11/00 Z

C 08 J 3/20 C E R Z

C 08 J 3/20 C E Z

【手続補正書】

【提出日】令和3年10月8日(2021.10.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

材料入口、および、処理材料出口を備えた処理容器を含む連続処理システムであって、材料は、前記容器を通って流れ、前記容器は、材料が通過する一連のゾーンに前記処理容器を分割する一連のディバイダを含み、作動中、前記ゾーンは、材料が前記ディバイダを流れて通過する速度を制御することによって互いから遮蔽されており、増大する真空レベルが、連続ゾーンに印加され、前記システムは、前記ディバイダと材料の接触によって処理材料にエネルギーを与える音響エネルギーを備える、システム。

【請求項2】

処理材料は、前記処理容器の頂部に導入され、重量下で前記処理装置を下方に前記ゾーンを通って通過し、前記処理材料出口を通って前記容器の底部に向かって離脱される、請求項1に記載のシステム。

【請求項3】

前記ディバイダは、前記処理材料を通過させるための穴を備える、請求項1または2に記載のシステム。

【請求項4】

前記処理容器を下る処理材料の流れは、処理材料が、前記ディバイダに設けられた穴を通して流れると同時に、十分な処理材料が、前記処理容器の前記ゾーンの間に遮蔽があることを確保するように処理材料が前記穴を通って流れると、ディバイダの設けられた前記穴にあるように、前記ディバイダによって制御される、請求項3に記載のシステム。

【請求項5】

前記処理容器に3つのゾーン、すなわち、第1のゾーン、第2のゾーン、および、第3のゾーンを含み、第1のゾーンは、処理材料が導入され、大気圧にあるゾーンであり、第2のゾーンは、第1のディバイダを越えた位置にあり、ゾーンの圧力が、大気圧の50%以下であるような印加された真空を有し、第3のゾーンは、第2のディバイダを越えた位

置にあり、第2のゾーンに印加された真空よりも大きな印加された真空を有し、第2のゾーンの圧力は、大気圧の25%以下であり、材料は、増大された真空下で容器から離脱される、請求項1～4のいずれか1項に記載のシステム。

【請求項6】

材料を処理するための方法であって、材料が、ディバイダによって一連のゾーンに分割されている処理容器に送られ、通過され、ゾーンは、処理中に互いから遮蔽され、徐々に増大する真空が、前記処理容器の連続ゾーンに印加され、音響エネルギーが、前記処理容器に印加され、前記ディバイダは、材料を通過させるための穴を備え、前記穴は、遮蔽を提供するために処理中に処理材料で覆われる、方法

【請求項7】

前記処理容器は、鉛直であり、処理材料は、重力および真空下で前記容器を通して流れ、請求項6に記載の方法。